

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

- I. 2017年から2021年までの過去5年間の米国特許・意匠・著作権・商標の出願/登録統計
- II. 2017年から2021年までの過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数
- III. 2021年新型コロナウイルス関連情報
- IV. 米国特許庁の極小企業と発明家に対する特別優遇

I. 過去5年間の米国出願・登録統計（2017～2021）

米国特許庁会計年度2017年から2021年にわたる過去5年間の米国特許・意匠出願統計を表1に纏めました。同時期の著作権登録統計と商標出願統計をそれぞれ表1Aと表1Bに纏めました。米国特許庁会計年度10月1日から翌年9月30日です。著作権を除き、以下の米国特許庁統計は、2021年会計年度報告書（USPTO FY 2021 Performance and Accountability Report）から入手したデータを使用しました。原本は<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf>で参照できます。

米国特許・意匠・商標に関する統計と著作権登録統計の概要は以下の通りです。

- (1) 表1：米国特許庁への特許出願総数 (utility, design, plant and reissue patent applications を含む) は2017年は約65万件でしたが、2018年は64万7千件程度に減少しました。2019年は、過去最高の66万6千件以上まで伸びました。その後、2020年は、また65万3千件まで減少し今年2021年も65万件に留まりました。同期間の外国起源%に示されている様に、出願件数の約半分は米国以外の国からの出願になっています。2021年の外国比を表すデータはまだ開示されていません。
- (2) 日本からの出願は2016年の9万1千件でした。その後減少して8万7-9千件程度を保っていましたが、2020年には10万件以上になり近年では最多です。2021年の日本からの出願件数は現時点は公表されていませんが、米国特許庁への総出願件数の毎年約14%を占めていて外国勢の中で首位を占めています。
- (3) 2017年～2020年の統計は、報告書に公表されている米国起源数と外国起源数の和が出願総数になりませんが、報告書に公表されている数字のままにしています。
- (4) 米国意匠出願数は、2017年から毎年着実に増えていて2021年には5万4千件を超えて昨年よりも約8千件増加しました。
- (5) 表1A：著作権の登録数は2014年(表1Aには含まれない)から2016年まで毎年減少の傾向にありました。2018年の登録数は増えて56万件になりましたが、2019年はまた減少の傾向にあり2020年は更にほぼ10万件的減少になりました。2021年の登録件数は現時点は公表されていません。尚、著作権登録には審査がありませんので、登録数と出願数はほぼ一致します。
- (6) 表1B：商標の出願総数は過去5年間で毎年増加の傾向にあり、括弧内の日本からの登録数も毎年増加しています。同様に、商標登録数も毎年増加しています。2021年の米国商標出願総数は943,928件で2020年から27.9%も増大しました。

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

表 1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2021 年	N/A	N/A	650,654 (593,294)	N/A	54,201
2020 年	302,251	355,031 (104,971)	653,311 (603,764)	54.3%	46,105
2019 年	316,076	350,759 (89,858)	666,843 (619,017)	52.5%	45,571
2018 年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360
2017 年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932

表 1 A Copyrights 著作権	Registrations 登録数
2021 年	N/A
2020 年	443,911
2019 年	547,837
2018 年	560,013
2017 年	452,122

(著作権の出願数の統計は見つかりませんでした)

表 1 B Trademarks 商標	Applications For Registration 米国出願数 (日本起源)	New Registrations (including classes) 新規登録数
2021 年	943,928 (7,982)	434,810
2020 年	738,112 (8,671)	400,298
2019 年	673,233 (8,779)	396,836
2018 年	638,847 (7,883)	367,382
2017 年	594,107 (7,340)	327,314

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

同様に2017年から2021年にわたる過去5年間の米国特許・意匠の登録統計を表2に纏めました。

- (1) 表1で示されている米国出願件数の様に、日本を含む米国以外の国からの出願人への登録数も表2では示されていませんが、約半分（50%）になっています。
- (2) その外国勢のなかで日本の登録数は2016年から2018年までの3年間減少の傾向にありましたが、2019年は5万3千件の登録数まで増加し2020年には5万6千件近くまでになっていました。しかし、日本の登録数は2021年にはほぼ7千件ほど登録数が減少しました。他の外国勢に比較して日本の米国特許の登録数は依然として首位です。表2の日本起源%で示されている様に2016年から2020年の間約14%を占めていますが減少傾向があります。
- (3) 2018会計年度の utility, design, plant and reissue patent applications を含む米国特許登録総数は約34万件で2017年に比べ約9千件ほど減少しましたが、2019年と2020年は飛躍的に約40万件まで増加しました。意匠も同様に2020年にかけて3万6千件まで増加しました。ところが、2021年の米国特許登録総数は約2万5千件ほど減少しました。
- (4) 植物に関連する Plant Patent の登録数は過去5年間で約1千件から1千2百件程度で安定しているようです。
- (5) 再審査による登録数は2017年(392件)から2020年(608件)にかけて大幅に増加しましたが、また2021年には100件ほど減少しました。2014年には800件以上もありました。

表2 GRANTS 米国登録数	Patent Grants U.S.Origin 米国起源	Patent Grants To Japan 日本起源	Patent Grants All Origins Total 総登録数	Patent Grants To Japan % Share 日本起源%	Utility Patent Grants 特許	Design Patent Grants 意匠	Plant Patent Grants 植物	Reissue Patent Grants 再審査
2021年	170,059	48,909	374,006	14.0%	338,335	33,914	1,256	501
2020年	188,344	55,899	399,055	14.0%	360,784	36,313	1,350	608
2019年	177,053	53,172	370,423	14.4%	336,846	31,830	1,193	554
2018年	161,965	50,012	339,512	14.7%	306,912	30,849	1,251	500
2017年	167,367	51,741	347,642	14.9%	315,367	30,637	1,246	392

Patent Grants（登録数）は utility, design, plant and reissue issues を含む

表3(特許)に2019年と2020年の国別の米国特許出願・登録数を纏めてみました。

- 1) 2021年の米国特許出願データは未だ公表されていませんが、外国勢のなかで日本は2018年～2020年登録数で、2018年～2020年出願数とともに首位です。
- 2) 表3にはありませんが、2014年の登録数はドイツと韓国がほぼ同数で二位で並んでいました。その後、韓国の登録数は2016年から2018年にかけて毎年ドイツより5千件ほど多く、韓国がドイツと中国を抜き2018年と2019年に二位になっていました。しかし、2020年には中国が2万6千件で韓国を

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

抜き二位になり 2021 年も 2 万 9 千件で二位を維持しました。2018 年～2021 年の間、日本の米国特許登録数は韓国(約 2 万 4 千件)と中国(約 2 万 6 千件)の 2 倍以上です。

- 3) その一方、特許出願数では、2017 年までは中国は三位でしたが、2018 年には 1 千件ほど韓国を抜き二位になっています。2018 年の中国の出願数は、3 万 8 千件近くあり、2019 年は、4 万 4 千件以上になりました。さらに 2020 年には中国は約 1 万件も出願数が増加しています。日本の出願数には約三万件少ないですが、登録数と出願数に関して短期間での著しい中国からの増加は顕著です。

米国特許：上位外国 5 カ国による出願数と登録数

表 3 国別順位	出願件数			登録件数		
	2020 年順位	2020 年	2019 年	2021 年順位	2021 年	2020 年
1	日本	84,971	89,858	日本	48,909	55,899
2	中国	54,378	44,285	中国	29,469	26,176
3	韓国	42,291	39,065	韓国	23,128	24,218
4	ドイツ	31,410	32,771	ドイツ	17,971	19,799
5	台湾	21,692	21,024	台湾	12,648	13,390

表 4 (商標)に国別の米国商標出願・登録数をまとめてみました。

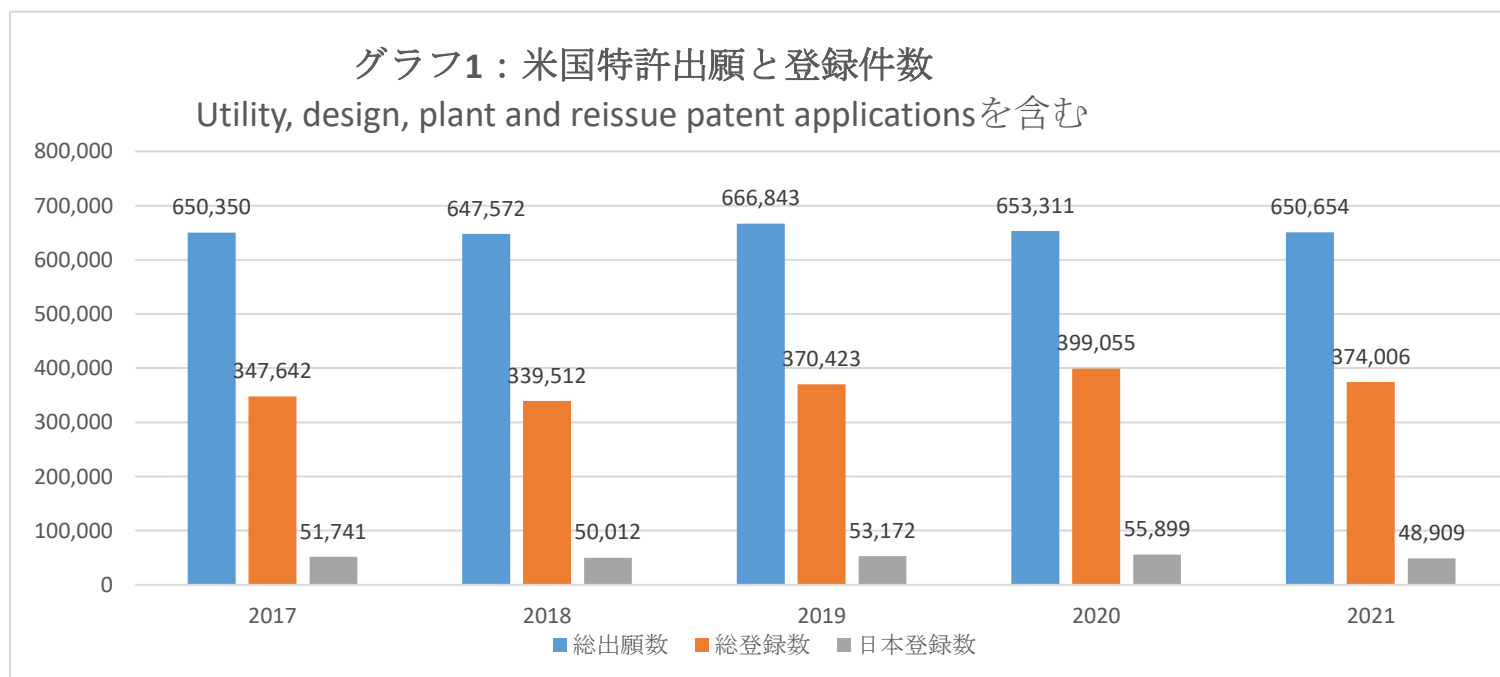
- 1) 国別の米国商標出願・登録数は、2020 年と 2021 年ともに外国勢のなかで中国が圧倒的に首位になっています。また、二位のカナダと比較すると、2021 年出願件数では中国がカナダのほぼ七倍で、登録数では中国がカナダのほぼ 10 倍という驚異的な米国商標の権利化を進めています。昨年はカナダのほぼ 9 倍だったので増加率は年々勢いをましています。
- 2) その一方、日本の米国商標出願・登録件数はカナダ・イギリス・ドイツ・韓国の後の六位です。日本の米国商標出願数は、カナダ・イギリス・ドイツの各国のおよそ半分程度です。昨年までは五位でしたが、韓国が 2021 年出願と登録件数で日本を上回りました。
- 3) 憶測ではありますが、日本は米国特許出願・登録に比べ米国商標出願・登録はかなり消極的のようです。

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

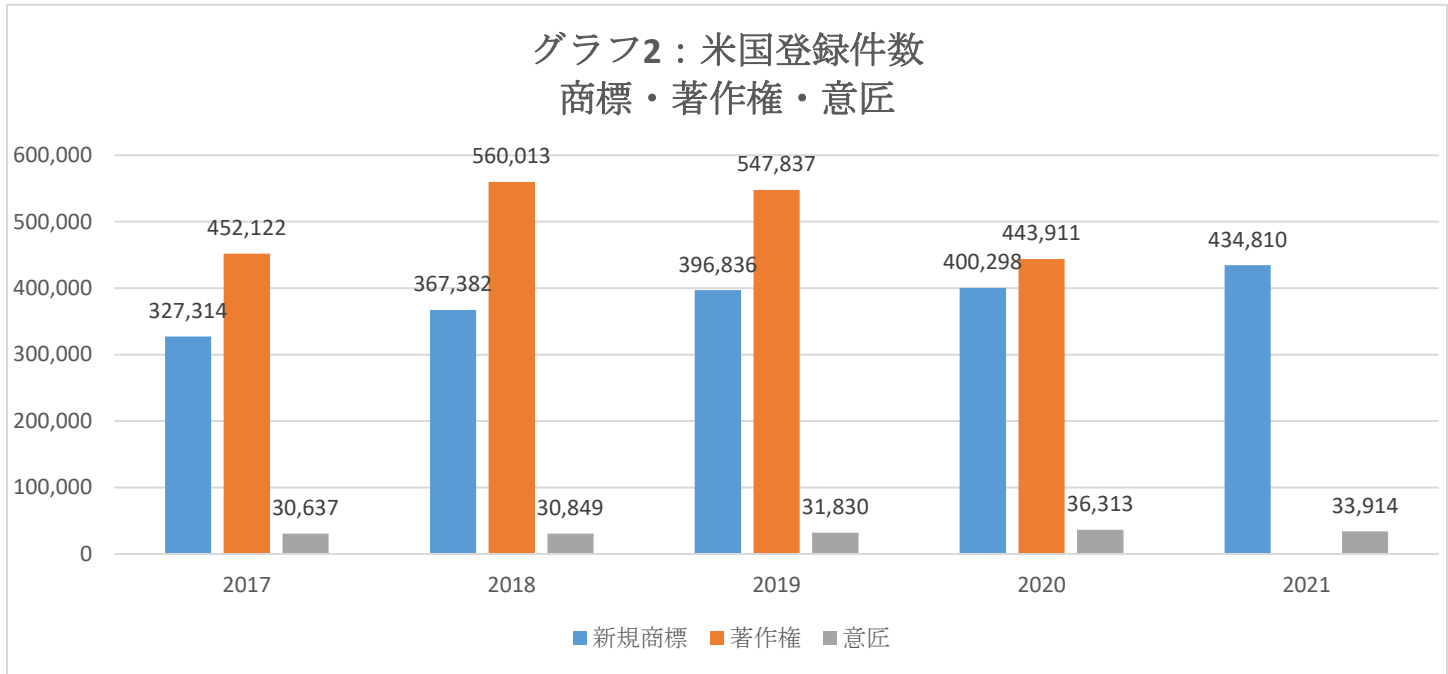
米国商標：上位5カ国による出願数と登録数

表4 国別順位	出願件数			登録件数		
	2021年順位	2021年	2020年	2021年順位	2021年	2020年
1	中国	228,445	102,593	中国	110,563	48,766
2	カナダ	19,912	16,431	カナダ	5,004	5,610
3	イギリス	17,971	15,288	イギリス		5,045
4	ドイツ	13,998	13,432	ドイツ	3,778	4,379
5	韓国	8,587	6,557	日本	3,092	3,372
6	日本	7,982	8,671	韓国	3,068	3,072

2017年から2021年にわたる過去5年間の米国特許出願と登録統計をグラフ1に纏めました。グラフ1の統計は、表1と表2の特許出願と登録(いずれも utility, design, plant and reissue patent applications を含む)を示し日本からの米国出願の登録数も示しています。



2017年から2021年にわたる過去5年間の米国意匠表1・著作権表1Aと商標表1Bの登録統計をグラフ2に纏めました。グラフ2の統計は表1、表1Aと表1Bを基にして纏めましたが、2021年の著作権登録数は公開されていません。



II. 過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数

会計年度2017年から2021年にわたる過去5年間の米国出願において中小企業による割合を検討しました。残念ながら、日本の中小企業の割合を直接示す統計は公表されていませんが、表5のUtility Patent登録の企業サイズのデータには、米国企業と外国企業の比率が記載されています。この外国中小企業データから表2の日本起源%の登録比率を基に日本中小企業の外国起源%に対する比率を計算しました。但し、表5の日本中小企業の比率は以下の仮定に基づく推測であります。表2の日本起源%の登録比率は、utility Patentだけでなく design, plant and reissue patent を含んだ登録であり、更に他の外国企業の大・中・小の企業数の比率が日本中小企業と同一しているとの仮定があります。

- (1) 表5よると米国企業と外国企業では、大企業 (Large Entity：総従業員数501人以上) に対しての小企業 (Micro Entity：Small Entityの各発明者の収入がおよそ\$190,662以下で年間4件以下出願) と中企業 (Small Entity：総従業員数500人以下又は非営利団体) の特許登録の比率に違いがあるようです。過去五年間の米国特許登録において米国大企業が占める割合は、ほぼ70%であります。これに対して、外国大企業が占める割合はほぼ85%です。つまり、外国の大企業に比べて、米国の大企業による登録数は米国中小企業の登録数に対し比率が低いということです。
- (2) これに相反して過去五年間の米国特許登録において米國中企業が占める割合は、ほぼ25%ですが、外国中企業が占める割合は、ほぼ14%です。同様に、過去五年間の米国特許登録において米國小企業が占める割合は、3%~4%ですが、外国小企業が占める割合は、1%以下です。表2で示されているように外国企業と米国企業の米国特許の登録数はほぼ同じです。つまり、外国の中小企業に比べて、米国の中小企業による登録数は米国大企業の登録数に対し比率が高いということです。

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

- (3) 米国企業と外国企業共に大・中・小企業間の登録数の比率は、過去五年間でほとんど変化がありません。
- (4) 表5によると外国企業と同様に、日本大企業による登録数の占める割合が高く、日本中小企業による米国特許の登録数の比率は低いようです。外国企業と同様に、日本大企業の登録する比率は日本中企業のほぼ6倍のようです。

表5
Patents
GRANTS
 米国特許登録

	Micro Entity 小企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)	Small Entity 中企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)	Large Entity 大企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)
--	--	--	--

2021年	4.23% 1.01% (0.141%)	27.02% 15.42% (2.16)	68.75% 83.57% (11.70)
2020年	4.20% 1.01% (0.141%)	25.92% 14.74% (2.06%)	69.88% 84.25% (11.80%)
2019年	4.22% 0.94% (0.134%)	25.82% 14.67% (2.09%)	69.97% 84.39% (12.06%)
2018年	4.34% 0.84% (0.123%)	25.91% 14.49% (2.13%)	69.75% 84.67% (12.44%)
2017年	4.06% 0.77% (0.114%)	25.68% 14.02% (2.08%)	70.26% 85.21% (12.69%)

表6は、2021会計年度の審査期間を技術分野別に示しています。第一回目の拒絶通知までに技術分野にもよりますが、最短でもほぼ13ヶ月かかり遅い技術分野では約一年半以上(18ヶ月)かかります。全審査の終了までに、早い技術分野でも約20ヶ月程度かかり、遅い技術分野では約2年半程度(27ヶ月)かかります。

表6 技術分野審査部門による審査期間 (単位：月)	第一回目の 拒絶通知まで	全審査の 終了まで
全ての技術分野の平均	16.9 (14.8)	23.3 (23.3)
Tech Center 1600—Biotechnology and Organic Chemistry (バイオ・有機化学)	17.0 (13.3)	24.0 (22.6)
Tech Center 1700—Chemical and Materials Engineering (化学・材料)	18.8 (16.8)	26.7 (26.9)
Tech Center 2100—Computer Architecture, Software, and Information Security (コンピュータ・ソフト・情報セキュリティ)	17.5 (16.0)	25.6 (26.5)

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

Tech Center 2400—Networks, Multiplexing, Cable, and Security (ネットワーク・マルチプレクシング・ケーブル・セキュリティ)	15.7 (12.9)	22.9 (23.1)
Tech Center 2600—Communications (通信)	13.5 (11.4)	19.9 (19.2)
Tech Center 2800—Semiconductor, Electrical, Optical Systems, and Components (半導体・電気・光学システム・部品)	15.7 (13.1)	22.3 (21.1)
Tech Center 3600—Transportation, Construction, Agriculture, and Electronic Commerce (交通・工事・農業・ネット通販)	18.1 (16.7)	25.9 (26.4)
Tech Center 3700—Mechanical Engineering, Manufacturing, and Products (機械工学・製造・製品)	18.6 (17.7)	26.7 (28.0)

上記の全審査終了までの期間の資料は、あくまでも審査が完了するまでの平均値で拒絶の回数や RCE の回数は考慮されていません。2021 年会計年度は 2020 年会計年度 (括弧内) に比べ第一回目拒絶の通知まで少々の後退 (1～2 か月程度) が見られたものの全審査の終了までの平均は 23.3 ヶ月では大きな違いはないようです。

表 7 は、2021 会計年度の審判に関連する統計です。表 7 に示した審判手続きは、代表的なものだけを選択しましたが、上記以外にも他の手続はあります。また、これらの手続からも特許庁管轄下の米国特許商標庁審判部 (Patent Trial and Appeal Board or PTAB) で控訴したり再考慮を申し立てすることも可能です。表 7 の総数は、年々減っており 2020 年は 7500 件でしたが 2021 年は 6988 件です。

- (1) Ex Parte Appeals は、審査からアピールした場合で 2021 年 9 月の時点で結果が出るまでに平均で 15 ヶ月ほどかかります。約 3 割ほど (33%) のアピールが認められ、1 割弱ほ (10%) は部分的にアピールが認められています。その一方、約 6 割弱ほど (55.5%) のアピールが却下されています。2021 年会計年度は 2020 年会計年度に比べほとんど大きな違いはないようです。
- (2) Reissue は、登録発行された特許の記載に間違い等があった場合に通常再発行されます。
- (3) Ex Parte Reexamination は、登録後に再審査を請求する手続で登録後 2 年以内であれば請求項の幅を稀に拡大することも可能です。2 年以降であれば請求項の幅を狭めることだけが許されています。特許権者が再審査手続をした案件は、16 件に留まり、大多数は、第三者が手続を提出したようです。
- (4) Supplemental Examination は、登録後の追加再審査で 2014 年の AIA 法に基づき施行された手続で、先行技術資料以外の証拠も活用でき先行技術以外の無効理由も主張できます。但し、追加再審査 (Supplemental Examination) は、特許権者しか利用できません。
- (5) IPR (Inter Partes Review) は、登録後に米国特許庁管轄の Patent Trial and Appeal Board (PTAB) で行われる先行技術資料に基づく無効簡易裁判です。米国連邦地方裁判所に提訴された特許侵害事件の約 8 割程度が PTAB でも無効審判のため重複して提訴されています。
- (6) PGR (Post Grant Review) は、登録後 9 ヶ月以内に米国特許庁管轄の PTAB で行われる先行技術とそれ以外の特許性にに基づく無効簡易裁判です。登録後 9 ヶ月以内に提訴しなければならぬので、その数は、IPR に比べると遥かに少数です。

表 7	案件数 (2021年提出分)
審判手続き	
Ex Parte Appeals	5,669 (5,521)
Ex Parte Reexamination (登録後再審査)	16
Supplemental Examination (AIA：追加再審査)	1 (特許権者のみ)
Inter Partes Review cases (IPR)	1,244 (1,308)
Post Grant Review cases (PGR)	58 (93)

III. 米国特許庁の新型コロナウイルス対策と解説

米国特許庁は、2020年には新型コロナウイルスの影響を考慮して複数の期間限定の緊急な救済対応策を打ち出しましたが、同年12月1日の時点で対応策は既に期限を過ぎてしまい2021年にはコロナ以外の発明を対象にした案件の緊急対応策はありませんでした。

2021年のコロナに関連した発明を対象にした出願の救済措置を説明いたします。米国特許庁によるとコロナ関連発明は、新型ウイルスに関連した製品か工程でFDAの承認が必要な案件と定義しました。

コロナに関連した発明を対象にした出願の救済措置：

1) COVID-19 Prioritized Examination Pilot Programは、2020年に開始され2021年12月31日までに
出願されるコロナ関連発明の新規出願を優先審査(prioritized examination)により一年以内に完了し、優先審査の特別料金を免除するとのことです。この措置は外国企業を含む中小企業出願人(SMALL & MICRO ENTITY ONLY)に限定しておりoriginal, nonprovisional utility or plant applicationsで優先権はパリ条約かPCTによる米国国内移行の両方に適用されます。

2) Fast-Track For COVID-19 Related Appeals Pilot Programは、2021年4月15日より上記1)の出願案件の審判手続き(Ex Parte Appeals)を無料で6ヵ月以内を目標にして判決(fast-track review)を下すそうです。

コロナ禍における米国特許と商標の出願傾向と対応：

コロナ禍において、上記表1Aに示すように2021年の米国特許出願総数は650,654件で2020年の653,311件より3千件(-0.4%)ほど減少しましたが、新型コロナウイルスの経済への影響を考慮すると多大な減少とは考えられません。また、米国特許庁は速やかにコロナ禍に対応しているようです。2021年会計年度は2020年会計年度に

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

比べ第一回目拒絶の通知まで少々の遅延（1～2か月程度+14.2%）が見られたものの、全審査の終了までの平均は23.3ヵ月では大きな違いはないようです。

日本の2020年の米国特許出願数(84,871件)は依然として外国勢の中で第一位の位置をしめています。しかしながら、2019年の米国特許出願数(89,858件)より約5千件ほど減少しています。その中で、中国の2020年の米国特許出願数(54,378件)は2019年の44,285件からほぼ1万件も増加しています。この増加率で行くと、中国は3年後には米国特許出願数で日本を追い抜くことになりかねません。

また、上記表1Bに示すように2121年の米国商標出願総数は943,928件で2020年の738,112件から27.9%も増大しました。増加した205,816件の内、中国の占める出願の割合は50%を超え、2121年の米国新規商標出願の総数(943,928件)のうち中国の米国新規商標出願(228,445件)は、なんと24%に及びます。つまり、米国新規商標出願のほぼ4件に一件が中国出願人です。これは米国商標によるブランド力の驚異的な強化に見えます。

コロナウイルス関連特許権の制限に対しての賛否両論：

特許制度と公衆衛生の両方の公正な運営の観点から、コロナウイルス関連特許権の制限は難しい問題である。2020年パテント誌に西口博之さんにより投稿された「新型コロナワクチンと特許制限」にはこの難しい問題の詳細が論じられている。ワクチンを開発した製薬会社からしてみれば、研究開発及び臨床実験費用・販売許可取得費用などの莫大コストを回収するための大きな要素が特許権である。ちなみに、日本の実績で新薬の開発期間は15—17年で成功率は6,000分の1だそうです。そして、一品目上市のために費やす開発費用は、260—360億円もかかるそうです。また、他の業界（通信・電気、自動車）に比べ、研究開発費の比率は約2倍程度の8%だそうです。このような理由により、製薬会社が特許権により収益を上げようとするのは致し方ないかもしれません。

その一方、今回の新型コロナに対し、後発途上国では危機的な公衆衛生問題にもかかわらず経済的な対応の限界があります。アフリカを中心とする後発途上国で深刻化した過去のエイズ・マラリア等の感染症でも同様な経済的な問題がありました。しかしながら、今回の新型コロナ問題は、東南アジアに端を発して欧米諸国など世界中に蔓延しているため、先進国でも後発途上国の公衆衛生問題に注意を払わなければなりません。つまり、自国の利益のために先進国が後発途上国の新型コロナ感染症問題を無視できない状況になっているようです。

このような急速な世界的感染の危機のなかで、新型コロナワクチンに関する特許権の強制ライセンスが提唱されています。米国の特許権は競争相手を排他することができるが、その弊害に対処するための制度として、公共の利益、不実施、利用関係を理由とする強制実施権が提唱されている。具体的には、世界保健機関（WHO）は、ワクチンを最初に開発した企業の特許権に制限をかけ、安くワクチンを供給することで協調を目指す決議案を採択したようです。

これに対して、米国では賛否両論があります。特許権の制限や強制ライセンスに反対する意見として、特許制度を根幹から脅かすという指摘があります。また、特許権制限等がかえってワクチンの供給は生産を遅らせることになる、特に後発途上国で不適切な生産によりワクチンの安全性が保てない、さらに膨大な投資による技術革新の妨げになり、しいては今後の医薬業界の衰退につながるというような議論があるようです。

過去のアフリカ諸国への先進国によるエイズ・マラリア等の感染症対策の支援と同等な支援が期待されています。日本を含め先進国によるワクチンを世界各地に公平に普及させる仕組み作りが課題となっていて、

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

世界保健機関によりCOVAXという組織が結成されワクチンが寄付されているようですが、現時点では後発途上国で2021年までに20億回分の接種の目標には達成していません。

IV. 米国特許庁の極小企業と発明家に対する特別優遇 (マイクロ・エンテティ) の解説

米国特許庁の中小企業 (Small Entity) に対して優遇措置は日本でも知られているが、極小企業と個人発明家に対する特別優遇 (Micro Entity) に対する特別優遇はあまり詳細には知られていないかもしれません。通常は中小企業 (Small Entity) の料金体系は、大企業 (Large Entity) の料金体系の50%であるのに対して、極小企業と個人発明家 (Micro Entity) の料金体系は、大企業 (Large Entity) の料金体系の25%であります。例えば、一件の米国出願に掛かる電子出願庁費用が大企業 (Large Entity) では \$ 1820、中小企業 (Small Entity) では \$ 910なのに対して極小企業と個人発明家 (Micro Entity) では \$ 455です。

極小企業と個人発明家 (Micro Entity) の特別な恩恵を受けるためには、Micro Entity Certification Form (SB/15Aまたは、SB/15B) という書類を出願時に提出し資格を確保しなければなりません。資格の一つ目として、収入に基づく (Gross Income Basis) ものがあります、又は資格の二つ目としては大学に参与している者 (Institution of Higher Education Basis) があります。何れにせよ、Micro Entityの資格には、中小企業 (Small Entity) の資格が前提条件になっています。

出願人の中小企業 (Small Entity) としての条件は、500人以下の従業員の企業で発明の権利を譲渡やライセンスをしていないことがあります。子会社や関連会社の従業員が上記の従業員数に含まれる場合もありますが、通常の場合は出願人企業の従業員数が判断に用いられます。

収入 (Gross Income Basis) に基づく資格の場合は、以下の四つの全ての条件が必要です。

- 1) 出願人がまず中小企業 (Small Entity) の条件を満たすこと
- 2) 同一出願人か発明家は4件までの米国出願に限定される (但し、PCT、仮出願と譲渡したか譲渡義務のある案件) は除く)。
- 3) 出願人か発明家の出願庁費支払いの一年前の年収が\$206,109以下であること
- 4) 出願人か発明家が上記3)の年収上限以上ある企業等 (entity) に発明の譲渡やライセンス契約をしていないこと

2021年：アメリカの知財事情に関するレポート

大学関係者に基づく資格 (Institution of Higher Education Basis) の場合は、下記 A) かB) のいずれかの条件が必要です。

A) 以下 1) と 2) の両方の条件が満たされていること

- 1) 出願人がまず中小企業(Small Entity)の条件を満たすこと
- 2) 出願人の大半の年収が雇用者である大学から支払われていること

B) 以下 1) と 2) の両方の条件が満たされていること

- 1) 出願人がまず中小企業 (Small Entity) の条件を満たすこと
- 2) 出願人が大学に発明の譲渡かライセンス契約をしているかまたは、譲渡かライセンスの義務があること

上記の説明は、あくまでも米国特許の費用に対する恩恵であります。しかしながら、出願に掛かる米国代理人費用にはほとんどの場合はこのような恩恵はありません。米国特許出願は、米国代理人を立てずに発明家や企業で直接することは可能ですが、英語力は勿論その他にも米国特許法や米国特許庁の手続の知識も必要なため容易ではないと思います。英語力があれば、日本人出願人が米国代理を立てずに米国審査官の手助け (Pro Se Assistance Program) を受けることも可能です。また、英語力があれば米国代理人と直接契約することも可能ですが、日本の特許事務所を経由するやり方が一般的になっています。